

Referenzverfahren

Bestimmung der Schichtdicke von Siliziumoxid-Filmen auf Silizium mit Elektronenspektroskopie (XPS/ESCA)

Kompetenznachweis

ISO/IEC 17025 Akkreditierung

Prüfgrößen und -objekte

Wafer

Objektgröße ca. (10 × 10) mm²

Prüfbereich

Siliziumoxid-Filmdicke bis 3 nm

Erweiterte Messunsicherheit ($k = 2$)

Relativ $U(n) = 2 \%$

Anwendungsbereich

Halbleiterindustrie

Referenzen

ISO 14701:2018, Surface chemical analysis - X-ray photoelectron spectroscopy - Measurement of silicon oxide thickness, <https://www.iso.org/standard/74818.html>.

Ansprechperson

Dr. Jörg Radnik

Joerg.Radnik@bam.de

030 8104-4548